ITPT半導体デバイス会合: 03/31/2003



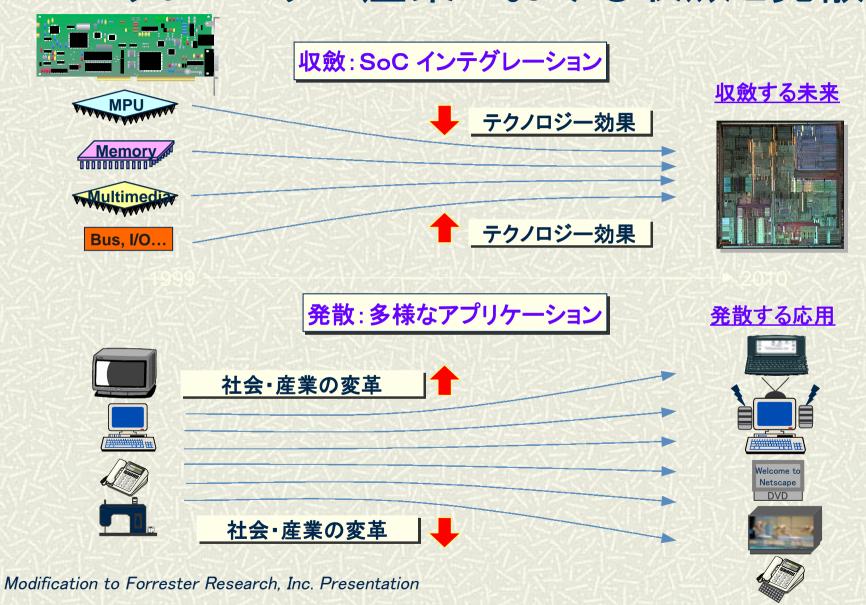
半導体産業とわが国の課題従来型モデルの限界

(株)東芝 香山 晋

基本認識と問題意識

- □ 日本の情報産業強化/IT化のプロセスは期待に 反しているが、半導体産業を確保することが成功 への絶対条件である
- # 半導体産業は、工業型と情報型の側面があり、日本はその両面で成功する必要がある
- ■日本の半導体産業は「微妙な」状況にある
 - 絶対的基盤の弱体化と相対的優位の回復過程にある
- #競争力の回復・強化のためには、本格的な業界再編、技術基盤整備と強力な政策的支援が不可欠
- #課題は、経営的混乱、技術的困難、経済環境、政策的課題、教育・研究体制・人事の問題、グローバリゼーション等々多岐にわたっており、体系的な対処が必須な状況にある

エレクトロニクス産業における収斂と発散

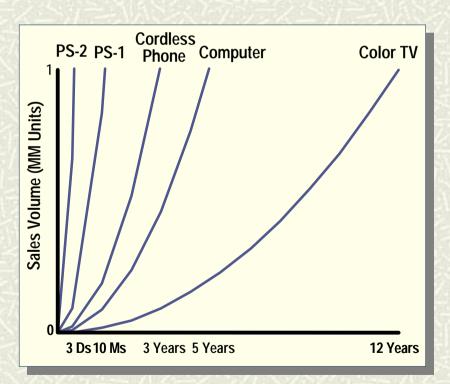


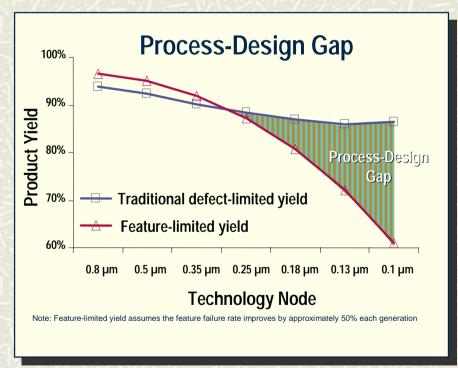
S. Kohyama 03/31/2003



プロセス技術と設計技術の統合/最適化

- ・ 歩留まり向上/量産立ち上げの急峻化
- ・ 設計の大規模化/高度化/複雑化
- ・ 統計的診断モデルの世代間格差拡大
- ・「学習」のための時間の「消滅」





市場導入から規模拡大までの時間

プロセスと設計のギャップ

S. Kohyama 03/31/2003

事業モデルのグローバルな変化

サクセスモデルの変調

- # IBMマイクロエレクトロニクス
 - ネットワークバブルの崩壊
 - コストダウン/オープン化対応要求の顕在化
 - 全社戦略との整合性
 - リストラ、アウトソーシング圧力の増大
 - Open ASIC/Value-added Foundry への転換
- # TSMC
 - 歩留まり低迷/プロセス再現性低下
 - Virtual IDM への転換
- # Fabless
 - Implementation のコスト急増/資金難
 - 上流設計への特化

変化の背景

130nmで傾向が顕著となり、90nmで顕在化

- #単なる微細化から、「技術統合」に変化
 - ■「装置選定」から「プロセス・インテグレーション」へ
- #集積度の飛躍的な向上で、設計が複雑化
 - SoC設計環境の再構築
- ■技術依存性の増加で、「論理設計」と「物理設計」の分離が不可能に
 - Implementation / Signal Integrity
- ♯マスク関連技術の重要性増大

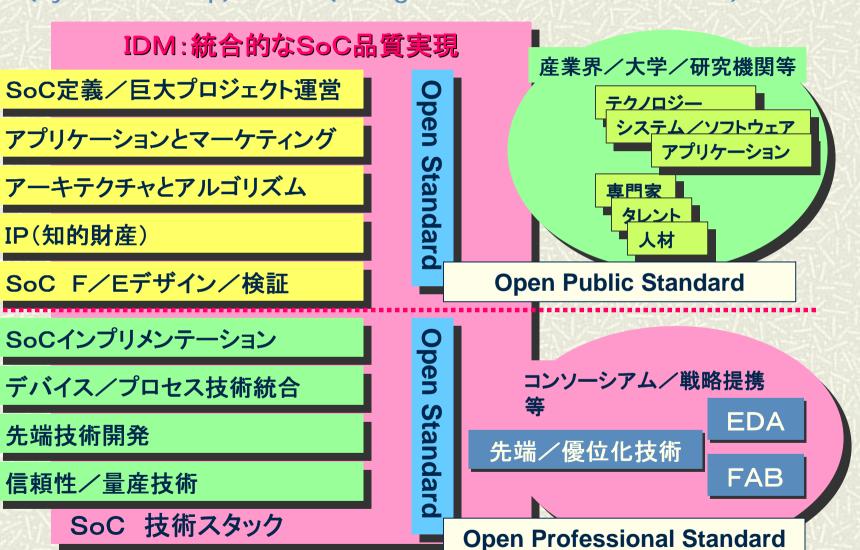
日本半導体のポジション

相対的地位の向上

- # 90nm 技術の完成度
 - ASPLAの存在価値の向上
- # Implementation/Optimization の力量
- ♯設計手法/環境の転換期
 - ■対等の出発点に立つ好機
- ■多様なIPの保有
 - ■標準化により相互利用/再利用も可能
- ヸマーケット/ユーザーの存在
 - Consumer/Automotive/Communication/Industry

SoC時代におけるIDMの役割

(System on Chip) (Integrated Device Manufacturer)



対応策と優先順位

- # 規制の徹底的な排除と大胆な産業政策導入
 - 市場原理主義(放任)は解を生まないが、古典的な規制も 解にはならない
- #「環境/安全/健康」を正面に掲げ、実際の努力を Broadband/Digital Consumer/Mobile/Securityに集 中
- #オープン化への対処とデファクト・スタンダード確保
 - ■「移動体通信」「ワイアレスLAN」「ディジタル映像/画像」
- # 半導体産業を統合的に捉え、構造的に再編・強化
 - IDM/メモリ/ファウンドリ/ファブレス/IP/EDA/サービス/装置/材料等々
 - 経営の革新の「強制」
- #大学/ベンチャー起業の体系的育成・強化
 - 徹底した自由化、海外システム/マネジメントの導入 03/31/2003